

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 6 月 26 日(26.06.2014)



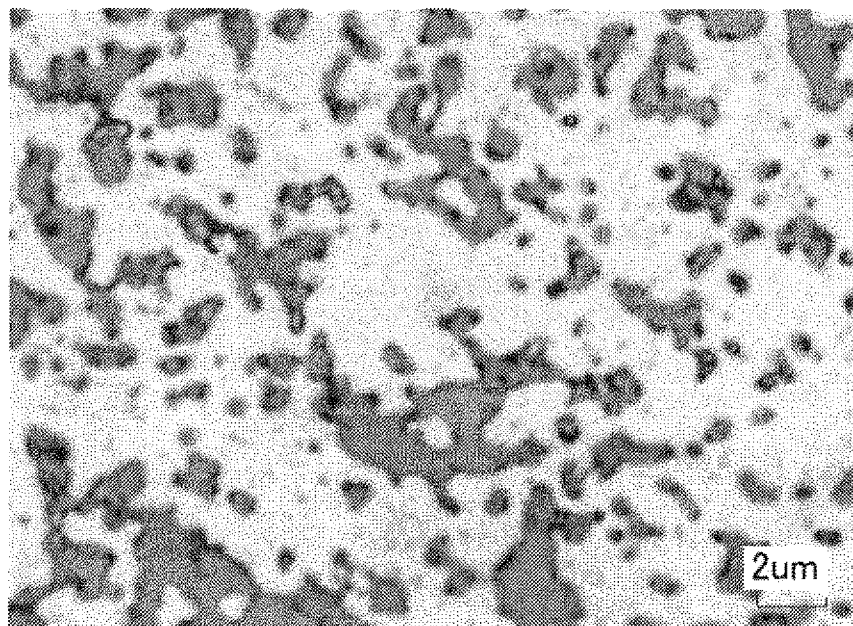
(10) 国際公開番号
WO 2014/097911 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) B22F 3/14 (2006.01)
C22C 19/07 (2006.01) B22F 3/15 (2006.01)
C22C 32/00 (2006.01) C22C 1/05 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/082917
- (22) 国際出願日: 2013 年 12 月 9 日(09.12.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-275288 2012 年 12 月 18 日(18.12.2012) JP
- (71) 出願人: J X 日鉱日石金属株式会社(JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 池田 祐希(IKEDA Yuki); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 小越 勇, 外(OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 9 番 1 4 号 発明会館 5 階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: SINTERED SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: 焼結体スパッタリングターゲット



(57) Abstract: A sintered sputtering target which comprises an alloy having a chemical composition containing 25 to 40 mol% of Cr and a remainder made up by Co and a non-metallic substance dispersed in the alloy, said sintered sputtering target being characterized in that the intensity ratio of the X-ray diffraction peak intensity of a σ phase of the Co-Cr alloy to that of the main peak is 0.02 or less. According to the present invention, the mechanical strength of the target can be improved, and therefore the cracking of the target during sputtering can be prevented and stable sputtering can be achieved.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2014/097911 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

Cr が 25mol%～40mol%、残余が Co からなる組成を有する合金と、その合金中に分散する非金属物質からなる焼結体スパッタリングターゲットであって、Co-Cr 合金の σ 相の X 線回折ピーク強度の強度比が、メインピークの X 線回折ピーク強度に対して、0.02 以下であることを特徴とする焼結体スパッタリングターゲット。本発明によれば、ターゲットの機械的強度を向上させることで、スパッタリングの際にターゲットの割れを抑制し、安定的なスパッタリングを実現できる。